

Plataforma de Nanotecnologia

Sol·licitud d' Alta d' Usuari Vinculat al Client

DADES DE L' USUARI*:

Nº D' USUARI:

Nº DE CLIENT:

* Persona que està vinculada a un CLIENT que assumeix el cost derivat de la prestació de serveis realitzats a la Plataforma.

Nom i Cognom del Client:	
Institut, Centre o Empresa:	
Departament / Laboratori:	
Nom i Cognom de l' Usuari:	
DNI:	
Nº Targeta PCB (només per a usuaris del PCB):	
Càrrec de l' Usuari:	
Telèfon de contacte:	
E-mail:	

Signatura del Client, segell de la institució i data:

CONDICIONS GENERALS

La signatura d'aquest document comporta:

1. - Que l'usuari/a ha llegit la documentació corresponent a la normativa i condicions d'ús de la Plataforma de Nanotecnologia. <http://www.ibecbarcelona.eu/services/nanotechnology-platform/>
2. - L'usuari/a haurà de citar la Plataforma de Nanotecnologia en les publicacions que derivin del servei prestat.

3. - L'IBEC no es fa responsable dels danys materials i/o personals derivats del mal ús de les instal·lacions i/o incompliment de les normes de seguretat i del pla d'emergència de l'edifici.

4. - L'incompliment d'aquestes normes comporta la pèrdua dels drets d'ús dels equips i instal·lacions de la Plataforma de Nanotecnologia.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les dades personals facilitades voluntàriament al present formulari seran incorporades i/o actualitzades en un fitxer automatitzat titularitat de la FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC), amb domicili social al C/Baldiri Reixac, 10-12, 08028 BARCELONA la finalitat del qual és gestionar la prestació de serveis, la difusió de formació i seminaris.

En qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu electrònic a l'adreça arco@ibecbarcelona.eu.

Dono consentiment a rebre informació científicotècnica i de la realització de formació i seminaris que organitzi l'IBEC mitjançant correu electrònic. **SI** **NO**

Seleccioneu els equips/instal·lacions que voleu utilitzar:

Time-of-the-Flight Ion Mass Spectroscopy (ToF-SIMS)	
Ultra-High Resolution Field Emission Scanning Electron Microscopy (SEM)	
E-beam Lithography (EBL)	
Nanoimprint Lithography (NIL)	
UV-Photolithography - Mask-aligner	
Direct Write Laser Lithography	
Thermal and E-beam metal evaporator	
Reactive Ion Etching (RIE)	
Inteferometer	
Profilometer	
Chemical Bath	
Spinner	
Plasma Cleaner	
Optical microscope	
Oven	
UV Curing Lamp Sytem	
Microarrayer	
Contact Angle	
Clean room	